PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-270035

(43) Date of publication of application: 02.10.2001

(51)Int.Cl.

B32B 15/08 B32B 27/34 H05K 1/03 H05K 3/00

(21)Application number : 2000-088279

(71)Applicant : UBE IND LTD

(22) Date of filing: 28.03.2000

(72)Inventor: YAMAMOTO TOMOHIKO

KATO KATSUZO

HOSOMA TOSHINORI

(54) FLEXIBLE METAL FOIL LAMINATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flexible metal foil laminate having a small dimensional stability even by sequentially treating an etching step and a heating step at the laminate obtained by laminating a polyimide and a metal foil.

SOLUTION: The flexible metal foil laminate is obtained by laminating a heat press bondable polyimide film and the metal foil by a continuously laminating device to obtain a long-sized laminate, and then thermally annealing the laminate at 150° C or higher or preferably 150° C to a glass transition temperature of the bondable polyimide.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-270035 (P2001-270035A)

(43)公開日 平成13年10月2日(2001.10.2)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F I			テーマコート*(参考)		
B 3 2 B 1	15/08		B 3 2 B 1	5/08		J 4F100		
					R			
2	27/34		2	7/34				
H 0 5 K	1/03	6 1 0	H 0 5 K	6 1 0 P				
	3/00		3/00		R			
			審査請求	未請求	請求項の数8	OL (全 8	頁)	
(21)出願番号		特願2000-88279(P2000-88279)	(71)出願人	0000002	206			
				宇部興	全株式会社			
(22)出願日		平成12年3月28日(2000.3.28)		山口県宇部市大字小串1978番地の96				
			(72)発明者	山本 智彦				
				山口県	字部市大字小串1	978番地の10	宇部	
				興産株式	式会社宇部ケミオ	カル工場内		
			(72)発明者	加藤朋	勝三			
				山口県等	宇部市大字小串1	978番地の10	宇部	
				興産株式	式会社宇部ケミナ	カル工場内		
			(72)発明者	細馬	敢徳			
				山口県	字部市大字小串1	978番地の10	宇部	
				與產株式	式会社宇部ケミカ	カル工場内		
						最終頁に	こ続く	

(54) 【発明の名称】 フレキシブル金属箔積層体

(57)【要約】

【課題】 ポリイミドと金属箔とを積層してなる、エッチング工程および加熱工程の逐次処理を加えても寸法変化が小さいフレキシブル金属箔積層体を提供する

【解決手段】 連続ラミネート装置によって熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とを積層して長尺状の積層体を得た後、150℃以上の温度、好ましくは150℃以上で熱圧着性ポリイミドのガラス転移温度より低い温度で熱アニール処理を施してなるフレキシブル金属箔積層体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 連続ラミネート装置によって熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とを積層して長尺状の積層体を得た後、150℃以上の温度で熱アニール処理を施してなるフレキシブル金属箔積層体。

【請求項2】 熱圧着性ポリイミドフィルムが、高耐熱性の芳香族ポリイミド層の少なくとも片面、好ましくは両面に熱圧着性の芳香族ポリイミド層を有するものである請求項1に記載のフレキシブル金属箔積層体

【請求項3】 金属箔が、電解銅箔、圧延銅箔、アルミニウム箔あるいはステンレス箔である請求項1に記載のフレキシブル金属箔積層体

【請求項4】 金属箔が、厚み 3μ m~ 35μ mの金属箔である請求項1あるいは2に記載のフレキシブル金属箔積層体

【請求項5】 熱圧着性ホリイミドフィルムが厚み7~ 50μ mである請求項1~3のいずれかに記載のフレキシブル金属箔積層体。

【請求項6】 熱圧着性ポリイミドフィルムが、共押出 一流延製膜成形法によって高耐熱性の芳香族ポリイミド 層の少なくとも片面、好ましくは両面に熱圧着性の芳香 族ポリイミド層を積層一体化して得られるものである請 求項1~5のいずれかに記載のフレキシブル金属箔積層 体。

【請求項7】 枚葉あるいはロール巻状態にある積層体に熱アニール処理を施してなる請求項1~6のいずれかに記載のフレキシブル金属箔積層体。

【請求項8】 連続ラミネート装置によって熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とが積層されてなる、常温でのエッチング工程および加熱工程の逐次処理による寸法変化率がいずれも|-0.04|%以下で、かつ累積寸法変化率が|-0.07|%以下であるフレキシブル金属箔積層体

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、フレキシブル金属箔積層体に関するものであり、さらに詳しくはエッチング工程および加熱工程の逐次処理を加えても寸法変化が小さく、ファインピッチ回路を形成する基板材料として好適なフレキシブル金属箔積層体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】カメラ、パソコン、液晶ディスプレイなどの電子機器類への用途として芳香族ポリイミドフィルムは広く使用されている。芳香族ポリイミドフィルムをフレキシブルプリント板(FPC)やテープ・オートメイティッド・ボンディング(TAB)などの基板材料として使用するためには、エポキシ樹脂などの接着剤を用いて銅箔を張り合わせる方法が採用されている。

【0003】芳香族ポリイミドフィルムは耐熱性、機械

的強度、電気的特性などが優れているが、接着剤の耐熱性等が劣るため、本来のポリイミドの特性を損なうことが指摘されている。このような問題を解決するために、接着剤を使用しないでボリイミドフィルムに銅を電気メッキしたり、銅箔にボリアミック酸溶液を塗布し、乾燥、イミド化したり、熱可塑性のポリイミドを熱圧着させたオールポリイミド基材が開発されている。しかし、これらの方法によって得られるオールボリイミドの金属箔積層体は、接着強度が小さいとか電気特性が損なわれるという問題点が指摘されている。

【0004】また、ボリイミドフィルムと金属箔との間にボリイミド接着剤をサンドイッチ状に接合したボリイミドラミネートが知られている(米国特許第4543295号)」しかし、このボリイミドラミネートでは、低熱線膨張のビフェニルテトラカルボン酸系ポリイミドフィルムについては接着強度が小さく使用できないという問題がある。

【0005】このため、ロールラミネート法においてラミネートロールの材質として特定の硬度を有する金属を使用する方法や、熱圧蓄性のポリイミドとして特定の芳香族ジアミンによって得られたものを使用する方法が提案されている。しかし、これらの方法によって得られるフレキシブル金属箔積層体も、エッチングおよび加熱処理の逐次処理を加えると、各工程の寸法変化率およびトータルの累積寸法変化率が大きくなり、電子回路のファインビッチ化の要求を満足することが困難であった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、ボリイミドと金属箔とを積層してなる、エッチング工程および加熱工程の逐次処理を加えても寸法変化が小さいフレキシブル金属箔積層体を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、この発明は、連続ラミネート装置によって熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とを積層して長尺状の積層体を得た後、150℃以上の温度、好ましくは150℃以上で熱圧着性ポリイミドのガラス転移温度より低い温度で熱アニール処理を施してなるフレキシブル金属箔積層体に関する。また、この発明は、連続ラミネート装置で熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とが積層されてなる、常温でのエッチング工程および加熱工程の逐次処理による寸法変化率がいずれも十±0.04 | %以下で、かつ累積寸法変化率がいずれも十±0.04 | %以下で、かつ累積寸法変化率がに関する。なお、前記の記載において、十±0.04 | %以下とは絶対値が0.04%であることを意味し、十±0.07 | %とは絶対値が0.07%であることを意味する。

[0008]

【発明の実施の形態】以下にこの発明の好ましい態様を 列記ずる。

- 1) 熱圧着性ポリイミドフィルムが、高耐熱性の芳香族ポリイミド層の少なくとも片面、好ましくは両面に熱圧着性の芳香族ポリイミド層を有するものである前記のフレキシブル金属箔積層体。
- 2)金属箔が、電解銅箔、圧延銅箔、アルミニウム箔あるいはステンレス箔である前記のフレキシブル金属箔積層体。
- 3) 金属箔が、厚み $3 \mu m \sim 35 \mu m$ の金属箔である前 記のフレキシブル金属箔積層体。
- 4) 熱圧着性ポリイミドフィルムが厚み 7~50 μ m である前記のフレキシブル金属箔積層体。
- 【0009】5) 熱圧着性ポリイミドフィルムが、共押出一流延製膜成形法によって高耐熱性の芳香族ポリイミド層の少なくとも片面、好ましくは両面に熱圧着性の芳香族ポリイミド層を積層一体化して得られるものである前記のフレキシブル金属箔積層体。
- 6) 枚葉あるいはロール巻状態にある積層体に熱アニール処理を施してなる前記のフレキシブル金属箔積層体。
- 【0010】この発明のフレキシブル金属箔積層体の構成としては、例えば次の組み合わせが挙げられる。次の記載でTPIーFは熱圧着性ポリイミドフィルムを示す。
- ①金属箔/TPI-F
- ②金属箔/TPI-F/金属箔
- 【0011】この発明においては、連続ラミネート装置で熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とを積層して長尺状の積層体を得た後、切断して枚葉としたあるいはアルミニウムやステンレス(SUS)などのコア材に巻き直してコア巻状態にある積層体を150℃以上、好ましくは150℃以上の温度で熱アニール処理を施すことが必要である。
- 【0012】この発明における熱圧着性ポリイミドフィルムは、例えば高耐熱性の芳香族ポリイミドの前駆体溶液を減膜の片面あるいは両面に熱圧着性の芳香族ポリイミドの前駆体溶液を積層した後、あるいは好ましくは、共押出し一流延製膜法によって高耐熱性の芳香族ポリイミドの前駆体(ポリアミック酸ともいう)溶液の片面あるいは両面に熱圧着性の芳香族ポリイミドまたはその前駆体溶液を積層した後、乾燥、イミド化して熱圧着性多層ポリイミドフィルムを得る方法によって得ることができる。
- 【0013】前記の熱圧着性多層ポリイミドフィルムにおける高耐熱性の芳香族ポリイミドは、好適には3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物(以下単にsーBPDAと略記することもある。)とパラーフェニレンジアミン(以下単にPPDと略記することもある。)と場合によりさらに4,4'ージアミノジフェニルエーテル(以下単にDADEと略記することもある。)および/またはピロメリット酸二無水物(以下単にPMDAと略記することもある。)とから製造され

る。この場合PPD/DADE(モル比)は100/0 ~85/15であることが好ましい。また、s-BPD $A \angle PMDAは100:0~50<math>\angle 50$ であることが好 ましい。また、高耐熱性の芳香族ポリイミドは、ピロメ リット酸二無水物とハラフェニレンジアミンおよび4, 4'ージアミノジフェニルエーテルとから製造される。 この場合DADE/PPD(モル比)は90/10~1 0/90であることが好ましい。さらに、高耐熱性の芳 香族ホリイミドは、3、3)、4、4)-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物(BTDA)およびピロメ リット酸二無水物(PMDA)とハラフェニレンジアミ ン(PPD)および4、4´ージアミノジフェニルエー テル(DADE)とから製造される。この場合、酸二無 水物中BTDAが20~90モル%、PMDAが10~ 80モル%、ジアミン中PPDが30~90モル%、D ADEが10~70モル%であることが好ましい。前記 の高耐熱性の芳香族ホリイミドの物性を損なわない範囲 で、他の種類の芳香族テトラカルボン酸二無水物や芳香 族ジアミン、例えば4,4'ージアミノジフェニルメタ ン等を使用してもよい。また、前記の芳香族テトラカル ボン酸二無水物や芳香族ジアミンの芳香環にフッ素基、 水酸基、メチル基あるいはメトキシ基などの置換基を導 入してもよい。

【0014】上記の高耐熱性の芳香族ポリイミドとしては、単層のポリイミドフィルムの場合にガラス転移温度が約350℃未満程度の温度では確認不可能であるものが好ましく、特に線膨張係数(50~200℃)(MD、TDおよびこれらの平均のいずれも)が5×10~~25×10°cm/cm/℃であるものが好ましい。この高耐熱性の芳香族ポリイミドの合成は、最終的に各成分の割合が前記範囲内であればランダム重合、ブロック重合、ブレンド、あるいはあらかじめ2種類以上のポリアミック酸溶液を合成しておき各ポリアミック酸溶液を混合してポリアミック酸の再結合によって共重合体を得る、いずれの方法によっても達成される。

【0015】この発明における熱圧着性ボリイミドとしては、300~400℃程度の温度で熱圧着できる熱可塑性ボリイミドであれば何でも良い。好適には1,3ービス(4ーアミノフェノキシベンゼン)(以下、TPE Rと略記することもある。)と2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸工無水物(以下、aーBPD Aと略記することもある。)とから製造される。また、前記の熱圧着性ポリイミドとしては、1,3ービス(4ーアミノフェノキシ)ー2,2ージメチルプロバン(DANPG)と4,4'ーオキシジフタル酸二無水物(ODPA)とから製造される。あるいは、4,4'ーオキシジフタル酸二無水物(ODPA)およびピロメリット酸二無水物と1,3ービス(4ーアミノフェノキシベンゼン)とから製造される。また、1,3ービス(3ーアミノフェノキシ)ベンゼンと3,3',4,4'ーベン

ゾフェノンテトラカルボン酸二無水物とから、あるいは3,3'ージアミノベンゾフェノンおよび1,3ービス(3ーアミノフェノキシ)ベンゼンと3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物とから製造される。

【0016】この熱圧着性ポリイミドの物性を損なわな い範囲で他のテトラカルボン酸二無水物、例えば3. 3′, 4, 4′ービフェニルテトラカルボン酸二無水。 物、2,2-ビス(3、4-ジカルボキシフェニル)フ ロパン二無水物などで置き換えられてもよい また、熱 圧着性ポリイミドの物性を損なわない範囲で他のジアミ ン、例えば4,4'ージアミノジフェニルエーテル、 4, 4'ージアミノベンゾフェノン、4, 4'ージアミ ノジフェニルメタン、2,2ービス(4ーアミノフェニ ル)プロハン、1、4ービス(4ーアミノフェノキシ) ベンゼン、4, 4'ービス(4ーアミノフェニル)ジフ エニルエーテル、4,4'ービス(4ーアミノフェニ ル) ジフェニルメタン、4, 4'ービス(4ーアミノフ ェノキシ) ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4-アミノフェノキシ) ジフェニルメタン、2, 2ービス 〔4一(アミノフェノキシ)フェニル〕プロパン、2, 2-ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル] へ キサフルオロプロパンなどの複数のベンゼン環を有する 柔軟な芳香族ジアミン、1, 4-ジアミノブタン、1, 6-ジアミノヘキサン、1,8-ジアミノオクタン、 1, 10-ジアミノデカン、1, 12-ジアミノドデカ ンなどの脂肪族ジアミン、ビス(3-アミノプロピル) テトラメチルジシロキサンなどのジアミノジシロキサン によって置き換えられてもよい。前記の熱圧着性の芳香 族ポリイミドのアミン末端を封止するためにジカルボン 酸類、例えば、フタル酸およびその置換体、ヘキサヒド ロフタル酸およびその置換体、コハク酸およびその置換 体やそれらの誘導体など、特に、フタル酸を使用しても よい。

【0017】前記の熱圧蓄性のポリイミドは、前記各成分と、さらに場合により他のテトラカルボン酸二無水物および他のジアミンとを、有機溶媒中、約100℃以下、特に20~60℃の温度で反応させてポリアミック酸の溶液とし、このポリアミック酸の溶液をドープ液として使用できる。この発明における熱圧着性のボリイミドを得るためには、前記の有機溶媒中、酸の全モル数(テトラ酸二無水物とジカルボン酸の総モルとして)の使用量がジアミン(モル数として)に対する比として、好ましくは0.92~1.1、特に0.98~1.1、そのなかでも特に0.99~1.1であり、ジカルボン酸の使用量がテトラカルボン酸二無水物のモル量に対する比として、好ましくは0.00~0.1、特に0.02~0.06であるような割合が好ましい。

【0018】また、ポリアミック酸のゲル化を制限する 目的でリン系安定剤、例えば亜リン酸トリフェニル、リ

ン酸トリフェニル等をホリアミック酸重合時に固形分 (ホリマー)濃度に対して0.01~1%の範囲で添加 することができる。また、イミド化促進の目的で、ドー フ液中に塩基性有機化合物系触媒を添加することができ る。例えば、イミダゾール、2ーイミダゾール、1、2 ージメチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾールな どをホリアミック酸(固形分)に対して0.01~20 重量%、特に0.5~10重量%の割合で使用すること ができる。これらは比較的低温でポリイミドフィルムを 形成するため、イミド化が不十分となることを避けるた めに使用する。また、接着強度の安定化の目的で、熱圧 着性の芳香族ポリイミド原料ドープに有機アルミニウム 化合物、無機アルミニウム化合物または有機錫化合物を 添加してもよい。例えば水酸化アルミニウム、アルミニ ウムトリアセチルアセトナートなどをポリアミック酸。 (固形分)に対してアルミニウム金属として1ppm以 上、特に1~1000ppmの割合で添加することがで きる

【0019】前記のボリアミック酸を得るために使用する有機溶媒は、高耐熱性の芳香族ボリイミドおよび熱圧 音性の芳香族ポリイミドのいずれに対しても、Nーメチルー2ーヒロリドン、N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nージエチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホルアミド、バーメチルカプロラクタム、クレゾール類などが挙げられる。これらの有機溶媒は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0020】前記の熱圧着性多層ポリイミドフィルムの製造においては、好適には共押出し一流延製膜法、例えば上記の高耐熱性の芳香族ポリイミドのポリアミック酸溶液の片面あるいは両面に熱圧着性の芳香族ポリイミドまたはその前駆体の溶液を共押出して、これをステンレス鏡面、ベルト面等の支持体面上に流延塗布し、100~200℃で半硬化状態またはそれ以前の乾燥状態とする方法が採用できる 200℃を越えた高い温度で流延フィルムを処理すると、熱圧着性多層ポリイミドフィルムの製造において、接着性の低下などの欠陥を来す傾向にある。この半硬化状態またはそれ以前の状態とは、加熱および/または化学イミド化によって自己支持性の状態にあることを意味する。

【0021】前記高耐熱性の芳香族ポリイミドを与えるポリアミック酸の溶液と熱圧着性の芳香族ポリイミドを与えるポリアミック酸の溶液との共押出しは、例えば特開平3-180343号公報(特公平7-102661号公報)に記載の共押出法によって二層あるいは三層の押出し成形用ダイスに供給し、支持体上にキャストしておこなうことができる。前記の高耐熱性の芳香族ポリイミドを与える押出し物層の片面あるいは両面に、熱圧着性の芳香族ポリイミドを与えるポリアミック酸溶液を積層して多層フィルム状物を形成して乾燥後、熱圧着性の

芳香族ボリイミドのガラス転移温度(Tg)以上で劣化が生じる温度以下の温度、好適には300~500℃の温度(表面温度計で測定した表面温度)まで加熱して(好適にはこの温度で1~60分間加熱して)乾燥およびイミド化して、高耐熱性(基体層)の芳香族ボリイミドを下の片面あるいは両面に熱圧着性の芳香族ホリイミドを有する熱圧着性多層ボリイミドフィルムを製造することができる

【0022】この発明における熱圧着性の芳香族ポリイミドは、前記の酸成分とジアミン成分とを使用することによって、ガラス転移温度が180~275℃、特に200~275℃であって、好適には前記の条件で乾燥・イミド化して熱圧着性ポリイミドのゲル化を実質的に起こさせないことによって得られる、ガラス転移温度以上で300℃以下の範囲内の温度で液状化せず、かつ弾性率が、通常275℃での弾性率が室温付近の温度(50℃)での弾性率の0.0002~0.2倍程度を保持しているものが好ましい」

【0023】この発明において、高耐熱性の(基体層)ポリイミド層の厚さは $5\sim120\,\mu$ m、特に $5\sim50\,\mu$ mであることが好ましい。 $5\,\mu$ m未満では作成した熱圧着性多層ポリイミドフィルムの機械的強度、寸法安定性に問題が生じる。また $120\,\mu$ mより厚くなると溶媒の除去、イミド化に難点が生じる。また、この発明において、熱圧着性の芳香族ポリイミド層の厚みは各々 $2\sim10\,\mu$ m、特に $2\sim8\,\mu$ m程度が好ましい。 $2\,\mu$ m未満では接着性能が低下し、 $10\,\mu$ mを超えても使用可能であるがとくに効果はなく、むしろフレキシブル金属箔積層体の耐熱性が低下する。また、熱圧着性の多層ポリイミドフィルムは厚みが $7\sim125\,\mu$ m、特に $7\sim50\,\mu$ mであることが好ましい。 $7\,\mu$ m未満では作成したフィルムの取り扱いが難しく、 $125\,\mu$ mより厚くなると溶媒の除去、イミド化に難点が生じる。

【0024】前記の共押出し一流延製膜法によれば、高耐熱性ポリイミド層とその片面あるいは両面の熱圧着性ポリイミドとを比較的低温度でキュアして熱圧着性ポリイミドの劣化を来すことなく、自己支持性フィルムのイミド化、乾燥を完了させることができ、良好な電気特性および接着強度を有する熱圧着性多層ポリイミドフィルムを得ることができる。

【0025】この発明において使用される金属箔としては、銅、アルミニウム、鉄、金などの金属箔あるいはこれら金属の合金箔など各種金属箔が挙げられるが、好適には圧延銅箔、電解銅箔などがあげられる。金属箔として、表面粗度の余り大きくなくかつ余り小さくない、好適にはRzが 7μ m以下、特にRzが 5μ m以下、特に $0.5\sim5\mu$ mであるものが好ましい。このような金属箔、例えば銅箔はVLP、LP(またはHTE)として知られている。金属箔の厚さは特に制限はないが、 70μ m以下、特に $3\sim35\mu$ mであることが好ましい。ま

た、Raが小さい場合には、金属箔表面を表面処理したものを使用してもよい

【0026】この発明においては、前記の熱圧着性ポリイミドフィルムと金属箔とを、ロールラミネートあるいはダブルベルトフレスなどの連続ラミネート装置に導入し、好適には導入する直前のインラインで150~250で程度に予熱して、加熱圧着して張り合わて、積層体を得る。特に、前記のダブルベルトフレスは、加圧下に高温加熱ー冷却を行うことができるものであって、熱媒を用いた液圧式のものが好ましい。

【0027】また、ロールラミネートまたはダブルベル トプレスの加熱圧着ゾーンの温度が熱圧着性ポリイミド のガラス転移温度より20℃以上高く400℃以下の温 度、特にガラス転移温度より30℃以上高く400℃以 下の温度で加圧下に熱圧着し、特にダブルベルトプレス の場合には引き続いて冷却ゾーンで加圧下に冷却して、 好適には熱圧着性ポリイミドのガラス転移温度より20 ℃以上低い温度、特に30℃以上低い温度まで冷却し て、積層体を得ることが好ましい。前記の方法におい て、製品が片面金属箔のフレキシブル金属箔積層体であ る場合には、剥離容易な高耐熱性フィルム、例えば前記 のRェが2μm未満の高耐熱性フィルムまたは金属箔、 好適にはポリイミドフィルム(宇部興産社製、ユービレ ックスS)やフッ素樹脂フィルムなどの高耐熱性樹脂フ ィルムや圧延銅箔などであって表面粗さが小さく表面平 滑性の良好な金属箔を保護材として、熱圧着性ポリイミ ド層と他の金属面との間に介在させてもよい。この保護 材は積層後、積層体から除いて巻き取っても良く、保護 材を積層したままで巻き取って使用時に取り除いてもよ V.

【0028】特に、ダブルベルトフレスを用いて加圧下に熱圧着一冷却して積層することによって、長尺で幅が約400mm以上、特に約500mm以上の幅広の、接着強度が大きく(90° ビール強度:0.7kg/cm以上、特に1kg/cm以上)、金属箔表面に皺が実質的に認めれられない程外観が良好なフレキシブル金属箔積層体を得ることができる。

【0029】この発明において、フレキシブル金属箔積層体は、熱圧着性多層ポリイミドフィルムおよび金属箔がロール巻きの状態でロールラミネートまたはダブルベルトプレスなどの連続ラミネート装置で積層して、ロール巻きの状態で長尺状の積層体とし、切断して枚葉としたあるいはアルミニウムやステンレス(SUS)などのコア材に巻き直してコア巻状態にある積層体を、150℃以上の温度、好ましくは150℃以上で熱圧着性ポリイミドのガラス転移温度より低い温度で熱アニール処理を施すことが必要であり、熱アニール処理を施さないか加熱処理しても温度が150℃未満であると、エッチングおよび加熱処理の逐次処理を加えていずれかの工程の寸法変化率が大きくなったりトータルの累積寸法変化率

が大きくなり、良好なフレキシブル金属箔積層体を得る ことが困難になる。

【0030】この発明により、前記の連続ラミネート装置で積層した積層体を熱アニール処理することによって、常温でエッチング後の寸法変化率および250℃で30分加熱処理後の寸法変化率がいずれも「±0.04「%以下、好適には±0.01~±0.04で、かつ常温でエッチング後の寸法変化率と250℃で30分加熱処理後の寸法変化率との合計である累積寸法変化率が「±0.07「%以下、好適には±0.001~±0.07であるフレキシブル金属箔積層体を得ることができる。フレキシブル金属箔積層体の前記各寸法変化率および累積寸法変化率のいずれかが前記範囲外であると、電子回路のファインピッチ化に適用することが困難である。

【0031】この発明によって得られるフレキシブル金 属箔積層体は、そのままあるいはロール巻き、エッチン グ、および場合によりカール戻し等の各処理を行った 後、必要ならば所定の大きさに切断して、電子部品用基。 板として使用できる。例えば、FPC、TAB、多層F PC、フレックスリジッド基板の基板として好適に使用 することができる。特に、金属箔の厚みが3~35μm で熱圧着性多層ポリイミドフィルム層の厚みが7~50 μmである片面銅箔積層体(全体厚みが15~85μ m) あるいは両面銅箔積層体(全体厚みが25~120 μm)から、エボキシ系接着剤あるいは熱可塑性ポリイ ミドや熱可塑性ポリアミドイミドあるいはホリイミドシ ロキサンーエポキシ系などの耐熱性ポリイミド系接着剤。 から選ばれる耐熱性接着剤(厚み5~50μm、好まし くは $5\sim15\mu$ m、特に $7\sim12\mu$ m)を用いて複数の - 銅箔積層体を接着することによって銅箔積層体が2~1-〇層で、高耐熱性・低吸水・低誘電率・高電気特性を満。 足する多層基板を好適に得ることができる。この発明の フレキシブル金属箔積層体には、長尺状のものだけでな く前記のように長尺状のものを所定の大きさに切断した。 ものも含まれる。

【0032】この発明のフレキシブル金属箔積層体には、それ自体公知のエッチング工程および加熱工程の逐次処理を加えて、回路基板として使用される。前記のエッチング工程としては、例えばフレキシブル金属箔積層体の銅箔などの金属箔を常温で塩化第二鉄水溶液などのエッチング処理液によってエッチング処理する方法が挙げられる。また、前記の加熱工程としては、例えばフレキシブル金属箔積層体を280℃の半田浴に10秒間程度浸漬する半田処理や、他のフレキシブル金属箔積層体と耐熱性接着剤によって積層して多層基板とする加熱圧着が挙げられる。

[0033]

【実施例】以下、この発明を実施例によりさらに詳細に 説明する。以下の各例において、物性評価は以下の方法 に従って行った。

●加熱収縮率:ポリイミドフィルムの加熱処理前と300℃で2時間加熱処理後の寸法変化を求め、%で表示した。

②エッチング後の寸法変化率:フレキシブル金属箔積層体のエッチング前と常温エッチング(43°C、エッチング) 塩化第二鉄水溶液)後の寸法変化を求め、%で表示した

③加熱処理後の累積寸法変化率:エッチング後、さらに250℃で30分間加熱処理しエッチング前との寸法変化を求め、%で表示した

●加熱処理による寸法変化率:加熱処理後の累積寸法変化率(③)からエッチングによる寸法変化率(②)を引いた寸法変化率

⑤熱線膨張係数:50~200℃、5℃/分で測定(TD、MDの平均値)、cm/cm/℃

⑥ガラス転移温度(Tg):粘弾性より測定。

⑦接着強度:90°剥離強度を測定し、平均値で評価

❸電気特性:体積抵抗をASTM D257で測定

⑨総合評価:○:寸法変化が小さく、90°剥離強度が1.0kgf/cm以上で接着強度が大きく、電気特性が良好、外観が良好、△:寸法変化がやや大きく普通△ ・・ は決変化が大きく不良

△、・: 寸法変化が大きく不良

【0034】高耐熱性の芳香族ポリイミド製造用ドーフの合成例1

攪拌機、窒素導入管を備えた反応容器に、N-メチルー2-ピロリドンを加え、さらに、パラフェニレンジアミンと3,3',4,4'-ピフェニルテトラカルボン酸工無水物とを<math>1000:998のモル比?でモノマー濃度が18%(重量%、以下同じ)になるように加えた。添加終了後50℃を保ったまま3時間反応を続けた。得られたホリアミック酸溶液は褐色粘調液体であり、25 でにおける溶液粘度は約1500ポイズであった。この溶液をドープとして使用した。

【0035】熱圧着性の芳香族ポリイミド製造用ドープ の合成-1

攪拌機、窒素導入管を備えた反応容器に、N-メチルー2-ヒロリドンを加え、さらに、1、3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼンと2、3、3、4、-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物とを<math>1000:1000のモル比でモノマー濃度が22%になるように、またトリフェニルホスフェートをモノマー重量に対して0.1%加えた。添加終了後25%を保ったまま 1 時間反応を続けた。このポリアミック酸溶液は、25%における溶液粘度が約2000ポイズであった。この溶液をドープとして使用した。

【0036】参考例1

上記の高耐熱性の芳香族ポリイミド用ドープと熱圧着性 の芳香族ポリイミド製造用ドープとを三層押出し成形用 ダイス(マルチマニホールド型ダイス)を設けた製膜装 置を使用し、金属製支持体上に流延し、140℃の熱風で連続的に乾燥し、固化フィルムを形成した。この固化フィルムを支持体から剥離した後加熱炉で200℃から320℃まで徐々に昇温して溶媒の除去、イミド化を行って、三層押出しポリイミドフィルムを巻き取りロールに巻き取った。得られた三層押出しポリイミドフィルムは、次のような物性を示した。

【0037】1)熱圧着性多層ポリイミドフィルムー1 厚み構成: 4μ m/ 17μ m/ 4μ m(合計 25μ m) 熱圧着性の芳香族ポリイミドのTg: 250 C 体積抵抗> 1×10^{-2} Ω・c m

この熱圧着性多層ポリイミドフィルムは、熱線膨張係数 $(50\sim200\%)$ が10+10 " $\sim25+10$ "× c m/c m/での範囲内であった。

【0038】比較例1

前記の熱圧着性多層ポリイミドフィルムー1と、2つのロール巻きした電解銅箔(三井金属鉱業社製、3ECーVLP、Rzが3.8 μ m、厚さ18 μ m)とを、ダブルベルトプレスに連続的に供給し、予熱後、加熱ゾーンの温度(最高加熱温度)380℃(設定)、冷却ゾーンの温度(最低冷却温度)117℃)で、連続的に加圧下に熱圧着一冷却して積層し、積層体(幅:約530mm、以下同じ)であるロール巻状物を得た。得られた積層体についての評価結果を次に示す。

エッチング後の寸法変化率:-0.01% 加熱処理後の累積寸法変化率:-0.11 加熱処理による寸法変化率:-0.10% 総合評価:×

【0039】比較例2

比較例1で得られたロール巻状の積層体を枚葉に切断し、イナートオーブン中、100℃で60分間加熱処理して、フレキシブル金属箔積層体を得た。得られたフレキシブル銅箔積層体についての評価結果を次に示す。エッチング後の寸法変化率:-0.01%加熱処理後の累積寸法変化率:-0.10加熱処理による寸法変化率:-0.09%総合評価:×

【0040】実施例1

比較例1で得られたロール巻状の積層体を枚葉に切断し、イナートオーブン中、200℃で60分間加熱して熱アニール処理を施して、フレキシブル金属箔積層体を得た。得られたフレキシブル銅箔積層体についての評価結果を次に示す。

エッチング後の寸法変化率:-0.02% 加熱処理後の累積寸法変化率:-0.06 加熱処理による寸法変化率:-0.04% 総合評価:○

【0041】実施例2

比較例1で得られたロール巻状の積層体を枚葉に切断し、イナートオーブン中、300℃で60分間加熱して熱アニール処理を施して、フレキシブル金属箔積層体を得た。得られたフレキシブル銅箔積層体についての評価結果を次に示す。

エッチング後の寸法変化率:-0.03% 加熱処理後の累積寸法変化率:-0.04 加熱処理による寸法変化率:-0.01% 総合評価:○

【0042】実施例3

比較例1で得られたロール巻状の積層体をアルミニウム のコア材に巻き直したコア巻き物を、イナートオーブン 中、260℃で60分間加熱して熱アニール処理を施し て、フレキシブル金属箔積層体を得た 得られたフレキ シブル銅箔積層体についての評価結果を次に示す。

エッチング後の寸法変化率:-0.02% 加熱処理後の累積寸法変化率:-0.05 加熱処理による寸法変化率:-0.03% 総合評価:○

【0043】実施例4

比較例1で得られたロール巻状の積層体をSUSのコア 材に巻き直したコア巻き物を、イナートオーブン中、2 60℃で60分間加熱して熱アニール処理を施して、フ レキシブル金属箔積層体を得た。得られたフレキシブル 銅箔積層体についての評価結果を次に示す。

エッチング後の寸法変化率: -0.03% 加熱処理後の累積寸法変化率: -0.06 加熱処理による寸法変化率: -0.03% 総合評価:○

【0044】実施例5~6

熱圧著性多層ポリイミドフィルムー1および厚み12 μ mの電解銅箔(三井金属鉱業社製)を使用するか、熱圧 着性多層ポリイミドフィルムー1および厚み9 μ mの電解銅箔(三井金属鉱業社製)を使用した他は実施例3と同様にして、ロール巻状の積層体、次いでコア巻き物(コア材質:アルミ)とし、熱アニール処理を施して、フレキシブル金属箔積層体を得た。得られたフレキシブル銅箔積層体についての評価結果はいずれも実施例3と同等で良好な結果を示した。

[0045]

【発明の効果】この発明によれば、以上のような構成を 有しているため、次のような効果を奏する。

【0046】この発明によれば、原料である熱圧着性ポリイミドフィルムの特性の如何に関わらず、エッチング工程および加熱工程の逐次処理を加えても寸法安定性の良いフレキシブル金属箔積層体を得ることができ、ファインピッチ回路を形成する基板材料を提供することができる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4F100 AB01B AB04B AB10B AB17B AB33B AK49A AK49C BA02 BA03 BA04 BA07 BA10B BA10C BA13 EA02 EH20 EJ41 EJ64 GB43 JA20A JA20B JJ03C JL04 JL12A

YYOO YYOOA YYOOB